

会告 2020年度第1回バルクセラミックスの信頼性に関するワークショップ

セラミックスの信頼性向上をさらに一歩進め、次世代のファインセラミックスを開発するためには、プロセスの研究者と評価研究者が議論して、製造時および稼働時の信頼性向上に資する新しい基礎科学と基盤技術を構築することが重要です。今回は、構造用セラミックスに加えて、電子セラミックスにおける信頼性の問題について議論したいと存じます。研究開発に対するヒントやアイデアを発見できる良い機会と思います。Web開催になりますが、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

主催：東京工業大学フロンティア材料研究所

共催：日本セラミックス協会バルクセラミックスの信頼性に関する基盤技術研究会

開催日時：2021年1月21日（木）14：00から16：30

場所：Web開催（zoomを利用）

参加費：無料

申込方法：下記HPにアクセスしていただき、お申し込みください。また、メールでのお申し込みでも結構です。所属、お名前、ご連絡先を記入してください。

<https://forms.gle/1VNQ1LYLo5JfEJ1q8>

プログラム（時間は目安です）

14：00-14：30「積層セラミックコンデンサにおける絶縁劣化箇所の特定制と可視化」

井澤 一欽（京セラ株式会社）

14：35-15：05「SPring-8放射光X線ナノCTによる電子デバイスの信頼性解析~MLCCの電極構造形成プロセス~」

大熊 学（物質材料研究機構）

休憩

15：15-15：45「マイクロカンチレバー曲げ試験によるセラミックスのメソスケール力学特性評価」

多々見純一（横浜国立大学）

15：50-16：20「波長掃引型光コヒーレンストモグラフィーによるセラミックス内部構造の非破壊評価技術」

高橋 拓実（神奈川県立産業技術総合研究所）

16：20 閉会

問合せ先：〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1

長岡技術科学大学 物質材料工学専攻 田中 諭

TEL: 0258-47-9337, FAX: 0258-47-9300 Email: stanaka@vos.nagaokaut.ac.jp